

明 細 書

発明の名称：

メタクリル酸メチル含有組成物及びメタクリル酸メチル重合体の製造方法 技術分野

[0001] 本発明は、メタクリル酸メチル含有組成物及びメタクリル酸メチル重合体の製造方法に関する。

背景技術

[0002] メタクリル酸メチル（以下「MMA」とも記す。）は様々な用途、種類のポリマーの原料として使用される極めて有用な物質であることが知られている。例えばメタクリル酸メチルのホモポリマーであるポリメタクリル酸メチルは、優れた透明性と耐候性などの特性を生かして、看板標識、照明機器、自動車部品、建築関連材料、フラットディスプレイ用の導光板、光拡散板などに使用されている。さらにメタクリル酸メチルと他のモノマーとのコポリマーは、塗料、接着剤、樹脂改質剤、人工大理石、紙ラテックスなどに使用されている。メタクリル酸メチルを工業的に製造する方法は種々開発されており、例えばアセトンシアノヒドリン（ACH）法、新アセトンシアノヒドリン（新ACH）法、C4直接酸化法、直メタ法、エチレン法、新エチレン法などが知られている（非特許文献1）。これらの製造方法では、生成したメタクリル酸メチルに含まれる未反応原料や副生成物などを除去するために蒸留などの精製を行って、目的の用途に適した品質のメタクリル酸メチルを得る。

[0003] メタクリル酸メチルは重合しやすい性質を有するため、メタクリル酸メチルの製造や、製造したメタクリル酸メチルを保管する際には重合禁止剤を添加してメタクリル酸メチルの品質を保つことが知られている（非特許文献2）。例えば特許文献1には、種々の重合禁止剤のうち、ヒドロキノンのメチルエーテル（MEHQ）が特に好ましいことが記載されている。特許文献2には、種々の重合禁止剤のうち、N，N'－ジアルキル－p－フェニレンジ

アミン及びN-オキシルが好ましいことが記載されている。特許文献3には、フェノール系の重合禁止剤の存在下でメタクリル酸メチルを蒸留することが記載されている。特許文献4には、ジフェニルアミン誘導体を重合禁止剤として用いることが記載されている。特許文献5には、ベンゼントリアミン誘導体を重合禁止剤として用いることが記載されている。

先行技術文献

特許文献

- [0004] 特許文献1：特開2004-155757号公報
特許文献2：特表2005-502695号公報
特許文献3：特表平10-504553号公報
特許文献4：特表2002-533309号公報
特許文献5：特表2002-513034号公報

非特許文献

- [0005] 非特許文献1：黒田 徹，「メタクリル酸メチル製造用触媒の開発」，触媒，一般社団法人触媒学会，2003年，第45巻，第5号，p. 366-371
非特許文献2：大津 隆行，「重合防止剤の機能について」，有機合成化学，公益社団法人有機合成化学協会，1975年，第33巻，第8号，p. 634-640

発明の概要

発明が解決しようとする課題

- [0006] しかしながら、前記重合禁止剤を添加した場合でも、メタクリル酸メチルは保管中に品質が悪化することがあった。以上の状況から、本発明の目的は保管中の品質安定性が高いメタクリル酸メチル含有組成物を提供することにある。

課題を解決するための手段

- [0007] 本発明者らは上記目的を達成するために鋭意検討を進めた。その結果、保

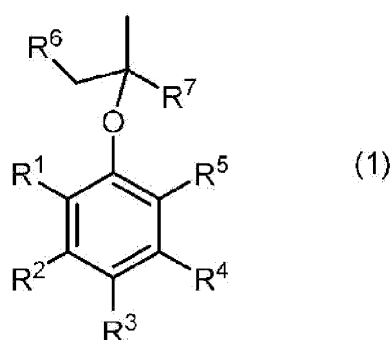
管中に品質が悪化したメタクリル酸メチルでは、メタクリル酸メチル濃度が減少し、メタクリル酸メチル二量体及びピルビン酸メチルが生成していることを見出した。メタクリル酸メチル中にメタクリル酸メチル二量体が含まれると、重合により得られるメタクリル酸メチルポリマーの構造が変化し、物性に悪影響を与える可能性がある。またメタクリル酸メチル中にピルビン酸メチルが含まれると、重合により得られるメタクリル酸メチルポリマーの着色の原因となる。そしてメタクリル酸メチル含有組成物が、特定の構造式のアリールアルキルエーテル化合物を含むことで、保管中の品質安定性が向上し、メタクリル酸メチル二量体及びピルビン酸メチルの生成が抑制されることを見出し、本発明を完成させた。

[0008] すなわち本発明は、以下の〔１〕から〔１８〕である。

〔１〕：メタクリル酸メチルと下記式（１）で表されるアリールアルキルエーテル化合物（成分Ａ）と、を含む、メタクリル酸メチル含有組成物であって、

メタクリル酸メチルの濃度が９９～９９．９９質量％である、メタクリル酸メチル含有組成物。

〔化１〕



（上記式（１）中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 及び R^7 は、独立して、水素原子、アルキル基、アルケニル基、アリール基、ヒドロキシ基、アルコキシ基、アミノ基、カルボニル基を含む１価の基、アルキルチオ基又はアリールチオ基を表す。）

〔2〕：前記成分Aの濃度をMA ($\mu\text{mol/L}$) としたとき、MAが1～10000 $\mu\text{mol/L}$ である、〔1〕に記載のメタクリル酸メチル含有組成物。

〔3〕：前記MAが10～5000 $\mu\text{mol/L}$ である、〔2〕に記載のメタクリル酸メチル含有組成物。

〔4〕：前記成分Aの分子量が2000以下である、〔1〕から〔3〕のいずれかに記載のメタクリル酸メチル含有組成物。

〔5〕：更に重合禁止剤（成分B）を含む、〔1〕から〔4〕のいずれかに記載のメタクリル酸メチル含有組成物。

〔6〕：前記成分Aの濃度をMA ($\mu\text{mol/L}$) とし、前記成分Bの濃度をMB ($\mu\text{mol/L}$) としたとき、MB/MAが0.005以上である、〔5〕に記載のメタクリル酸メチル含有組成物。

〔7〕：前記成分Bの濃度をMB ($\mu\text{mol/L}$) としたとき、MBが1～7000 $\mu\text{mol/L}$ である、〔5〕または〔6〕に記載のメタクリル酸メチル含有組成物。

〔8〕：前記MBが10～5000 $\mu\text{mol/L}$ である、〔6〕又は〔7〕に記載のメタクリル酸メチル含有組成物。

〔9〕：前記成分Bが、フェノール系化合物、キノン系化合物、ニトロベンゼン系化合物、N-オキシル系化合物、アミン系化合物、リン含有化合物、硫黄含有化合物、鉄含有化合物、銅含有化合物及びマンガン含有化合物からなる群から選択される少なくとも1種の重合禁止剤である、〔5〕から〔8〕のいずれかに記載のメタクリル酸メチル含有組成物。

〔10〕：前記成分Bが、フェノール系化合物、N-オキシル系化合物、アミン系化合物、リン含有化合物、及び硫黄含有化合物からなる群から選択される少なくとも1種の重合禁止剤である、〔5〕から〔9〕に記載のメタクリル酸メチル含有組成物。

〔11〕：前記成分Bが、ヒドロキノン、4-メトキシフェノール、2,4-ジメチル-6-tert-ブチルフェノール、2,6-ジ-tert-ブチル-4-メ

チルフェノール、4-ヒドロキシ-2, 2, 6, 6-テトラメチルピペリジーン-N-オキシル、N, N-ジフェニルアミン、N-ニトロソジフェニルアミン、トリフェニルホスファイト及びフェノチアジンからなる群から選択される少なくとも1種の重合禁止剤である、[5] から [10] のいずれかに記載のメタクリル酸メチル含有組成物。

[12] : メタクリル酸メチルの濃度が99. 8~99. 99質量%である、[1] から [11] のいずれかに記載のメタクリル酸メチル含有組成物。

[13] : ジアセチルを含有しない、又は含有するジアセチルの濃度が55 $\mu\text{mol/L}$ 以下である、[1] から [12] のいずれかに記載のメタクリル酸メチル含有組成物。

[14] : 前記式(1)中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 及び R^7 がそれぞれ独立して、水素原子、炭素原子数1~5のアルキル基、炭素原子数2~5のアルケニル基、炭素原子数1~12のアリール基、ヒドロキシ基、炭素原子数1~6のアルコキシ基、アミノ基又はカルボニル基を含む1価の基である、[1] から [13] のいずれかに記載のメタクリル酸メチル含有組成物。

[15] : 前記式(1)中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 及び R^7 がそれぞれ独立して、水素原子、炭素原子数1~5のアルキル基、ヒドロキシ基、炭素原子数1~5のアルコキシ基又は炭素原子数2~6のアルコキシカルボニル基である、[1] から [14] のいずれかに記載のメタクリル酸メチル含有組成物。

[16] : 前記式(1)中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 及び R^7 がそれぞれ独立して、水素原子、メチル基、t-ブチル基、ヒドロキシ基、メトキシ基又はメトキシカルボニル基である、[1] から [15] のいずれかに記載のメタクリル酸メチル含有組成物。

[17] : [1] から [16] のいずれかに記載のメタクリル酸メチル含有組成物を含む重合性組成物を重合する工程を含む、メタクリル酸メチル重合体の製造方法。

[18]：前記重合性組成物が、メタクリル酸メチルと共重合可能な単量体を含む、[17]に記載のメタクリル酸メチル重合体の製造方法。

発明の効果

[0009] 本発明によれば、保管中のメタクリル酸メチル二量体及びピルビン酸メチルの生成が抑制された、品質安定性の高いメタクリル酸メチル含有組成物を提供することができる。

発明を実施するための形態

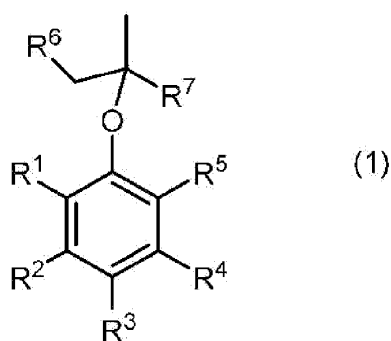
[0010] 以下、本発明に係る実施形態について説明するが、本発明は以下に限定されるものではない。

本明細書において、「～」を用いて表される数値範囲は、「～」の前後に記載された数値を下限値及び上限値として含む範囲を意味し、「A～B」は、A以上B以下であることを意味する。

[0011] [メタクリル酸メチル含有組成物]

本発明に係るメタクリル酸メチル含有組成物は、メタクリル酸メチルと、下記式(1)で表されるアリールアルキルエーテル化合物(成分A)と、を含む、メタクリル酸メチル含有組成物であって、メタクリル酸メチルの濃度が99～99.99質量%である。

[化2]



[0012] 上記式(1)中、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶及びR⁷は、独立して、水素原子、アルキル基、アルケニル基、アリール基、ヒドロキシ基、アルコキシ基、アミノ基、カルボニル基を含む1価の基、アルキルチオ基又はアリ

ールチオ基を表す。

また、該メタクリル酸メチル含有組成物はメタクリル酸メチルの濃度が99～99.99質量%を満たす限り、重合禁止剤（成分B）、その他の化合物（成分C）や水を含むしてもよい。以下各項目について詳細に説明する。

[0013] （成分A）

本発明に係るメタクリル酸メチル含有組成物は、前記式（1）で表されるアリールアルキルエーテル化合物（成分A）を含む。メタクリル酸メチル含有組成物が成分Aを含むことにより、メタクリル酸メチル含有組成物保管中のメタクリル酸メチル二量体及びピルビン酸メチルの生成を抑制することができる。この理由としては、以下のように推定される。

[0014] メタクリル酸メチル二量体は、メタクリル酸メチルの保管中に発生するラジカルによって生成する。該ラジカルの例として、酸素分子が太陽光由来の紫外光を吸収して生成するヒドロキシラジカルが挙げられる。またヒドロキシラジカルは、メタクリル酸メチルの酸化によるピルビン酸メチル生成の原因にもなる。アリールアルキルエーテル化合物は、ベンゼン環を有する π 共役系化合物であるため紫外光を吸収し、その吸収波長は置換基の種類によって変化する。前記式（1）で表される構造を有するアリールアルキルエーテル化合物（成分A）は、幅広い波長の紫外光を吸収することができる。よって、メタクリル酸メチル含有組成物が成分Aを含む場合、幅広い波長の紫外光が吸収され、ヒドロキシラジカルの生成が抑制される。よってメタクリル酸メチル二量体及びピルビン酸メチルの生成が抑制されると推定される。

[0015] 成分Aの分子量は2000以下であることが好ましい。分子量が2000以下であることにより、成分Aにおける単位質量あたりのベンゼン環の個数を増やすことができるため、少ない質量で本発明の効果を得ることができる。成分Aの分子量は1600以下がより好ましく、1200以下がさらに好ましく、800以下が特に好ましい。

[0016] 前記式（1）中の R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 及び R^7 は、独立して、水素原子、アルキル基、アルケニル基、アリール基、ヒドロキシ基、アルコ

キシ基、アミノ基、カルボニル基を含む1価の基、アルキルチオ基又はアリールチオ基を表す。R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶及びR⁷は同一でも異なっているもよい。

[0017] R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶及びR⁷が前記条件を満たす場合、成分Aの π 共役系が維持され、幅広い波長の紫外光を吸収できるため、ヒドロキシラジカルの生成が抑制され、本発明の効果をを得ることができる。紫外光の吸光度を上昇させてヒドロキシラジカルの生成を抑制する観点から、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶及びR⁷は水素原子、炭素原子数1～5のアルキル基、炭素原子数2～5のアルケニル基、炭素原子数1～12のアリール基、ヒドロキシ基、炭素原子数1～6のアルコキシ基、アミノ基又はカルボニル基を含む1価の基であることが好ましく、水素原子、炭素原子数1～5のアルキル基、ヒドロキシ基、炭素原子数1～5のアルコキシ基又は炭素原子数2～6のアルコキシカルボニル基であることがより好ましく、水素原子、メチル基、*n*-ブチル基、ヒドロキシ基、メトキシ基又はメトキシカルボニル基であることがさらに好ましい。

[0018] アルキル基は、鎖状（直鎖又は分岐）アルキル基又は環状アルキル基である。炭素原子数1～20のアルキル基が好ましく、炭素原子数1～10のアルキル基がより好ましく、炭素原子数1～5のアルキル基がさらに好ましい。鎖状アルキル基としては例えば、メチル基、エチル基、*n*-プロピル基、イソプロピル基、*n*-ブチル基、イソブチル基、*s*-ブチル基、*t*-ブチル基、*n*-ペンチル基、イソペンチル基、ヘキシル基、オクチル基、デシル基、ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシエチル基などが挙げられ、メチル基、エチル基、*n*-プロピル基、イソプロピル基が好ましい。また環状アルキル基としては例えば、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロオクチル基などが挙げられる。

[0019] アルケニル基は、鎖状（直鎖又は分岐）アルケニル基又は環状アルケニル基である。炭素原子数2～20のアルケニル基が好ましく、炭素原子数2～10のアルケニル基がより好ましく、炭素原子数2～5のアルケニル基がさ

らに好ましい。鎖状アルケニル基としては例えば、ビニル基、1-プロペニル基、イソプロペニル基、2-ブテニル基、1,3-ブタジエニル基、2-ペンテニル基、2-ヘキセニル基などが挙げられる。また環状アルケニル基としては例えば、シクロペンテニル基、シクロヘキセニル基などが挙げられる。

[0020] アリール基は、炭素原子数が1～20のアリール基が好ましく、炭素原子数1～12のアリール基がより好ましい。アリール基は酸素、窒素、硫黄等を含有するヘテロアリール基を含む。アリール基としては例えば、フェニル基、メシチル基、ナフチル基、2-メチルフェニル基、3-メチルフェニル基、4-メチルフェニル基、2,3-ジメチルフェニル基、2,4-ジメチルフェニル基、2,5-ジメチルフェニル基、2,6-ジメチルフェニル基、2-エチルフェニル基、イソキサゾリル基、イソチアゾリル基、イミダゾリル基、オキサゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル基、チエニル基、トリアゾリル基、テトラゾリル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラゾリル基、ピロリル基、フリル基、フラザニル基、イソキノリル基、イソインドリル基、インドリル基、キノリル基、ピリドチアゾリル基、ベンゾイミダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリアゾリル基、ベンゾフラニル基、イミダゾピリジニル基、トリアゾピリジニル基、プリニル基などが挙げられる。

[0021] アルコキシ基は、炭素原子数1～20のアルコキシ基が好ましく、炭素原子数1～10のアルコキシ基がより好ましく、炭素原子数1～6のアルコキシ基がさらに好ましい。アルコキシ基としては例えば、メトキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基、イソプロポキシ基、n-ブトキシ基、イソブトキシ基、s-ブトキシ基、t-ブトキシ基、n-ペントキシ基、イソペントキシ基、フェノキシ基などが挙げられる。

[0022] アミノ基は、窒素原子上に置換基のないアミノ基($-NH_2$)と、窒素原子と結合した水素原子の一部または全部が炭素原子で置換されたアミノ基を含む。炭素原子で置換されたアミノ基の炭素原子数は1～20が好ましく、1

～10がより好ましく、1～5がさらに好ましい。アミノ基としては例えば、メチルアミノ基、エチルアミノ基、プロピルアミノ基、ブチルアミノ基、ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、アニリノ基、トリイジノ基、アニシジノ基、ジフェニルアミノ基、N-メチル-N-フェニルアミノ基などが挙げられる。

[0023] カルボニル基を含む1価の基としては、ホルミル基、アシル基、カルボキシ基、アミド基、アルコキシカルボニル基、チオカルボキシ基、チオエステル基、等が挙げられる。

[0024] アシル基は、カルボニル基とアルキル基、アルケニル基、又はアリール基が連結した置換基である。アシル基のカルボニル基由来の炭素原子数（1個）とアルキル基、アルケニル基、又はアリール基由来の炭素原子数の合計は2～20が好ましく、2～10がより好ましく、2～6がさらに好ましい。アシル基としては例えば、アセチル基、プロピオニル基、ブチルカルボニル基、ビニルカルボニル基、ベンゾイル基などが挙げられる。

[0025] アミド基は、窒素原子上に置換基のないアミド基（ $-\text{CONH}_2$ ）と、窒素原子と結合した水素原子の一部または全部が炭素原子で置換されたアミド基を含む。アミド基の炭素原子数は、カルボニル基由来の炭素原子数（1個）と窒素原子上に置換された炭素原子数の合計で、1～20が好ましく、1～10がより好ましく、1～5がさらに好ましい。アミド基としては例えば、無置換のアミド基、N-メチルアミド基、N-エチルアミド基、N-フェニルアミド基、N,N-ジメチルアミド基、N-メチル-N-フェニルアミド基などが挙げられる。

[0026] アルコキシカルボニル基は、カルボニル基とアルコキシ基が連結した置換基でエステル基とも呼ばれる。カルボニル基由来の炭素原子数（1個）とアルコキシ基由来の炭素原子数の合計は、2～20が好ましく、2～10がより好ましく、2～6がさらに好ましい。アルコキシカルボニル基としては例えば、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、ブトキシカルボニル基、フェノキシカルボニル基などが挙げられる。

- [0027] チオエステル基は、カルボニル基とアルキルチオ基又はアリールチオ基が連結した置換基である。カルボニル基由来の炭素原子数（１個）とアルキルチオ基又はアリールチオ基由来の炭素原子数の合計は、２～２０が好ましく、２～１０がより好ましく、２～６がさらに好ましい。チオエステル基としては例えば、メチルチオカルボニル基、エチルチオカルボニル基、ブチルチオカルボニル基、フェニルチオカルボニル基などが挙げられる。
- [0028] また、カルボニル基を含む１価の基としては、アルキル基の１つ又は複数の水素がカルボニル基に置換された置換基でもよい。このような置換基としては、例えば、２－アセトキシエチル基、２－アセトエチル基、２－（アセトアセトキシ）エチル基などが挙げられる。
- [0029] アルキルチオ基は、炭素原子数１～２０のアルキルチオ基が好ましく、炭素原子数１～１０のアルキルチオ基がより好ましく、炭素原子数１～５のアルキルチオ基がさらに好ましい。アルキルチオ基としては例えば、メチルチオ基、エチルチオ基、プロピルチオ基、イソプロピルチオ基などが挙げられる。
- [0030] アリールチオ基は、炭素原子数１～２０のアリールチオ基が好ましく、炭素原子数３～１０のアリールチオ基がより好ましく、炭素原子数６～１０のアリールチオ基がさらに好ましい。アリールチオ基としては例えば、フェニルチオ基、トリルチオ基などが挙げられる。
- [0031] 上記の条件を満たす化合物の中でも、メタクリル酸メチル含有組成物の保管中の品質安定性の観点から、成分Ａとしては、ｔ－ブチルフェニルエーテル、イソプロピルフェニルエーテル、１－イソプロポキシ－３－メチルベンゼン、４－イソプロポキシフェノール、１－ｔ－ブトキシ－４－メチルベンゼン、２－（２，４－ジメチル－６－ｔ－ブチルフェノキシ）－２－メチルプロピオン酸メチル、２－（２，６－ジ－ｔ－ブチル－４－メチルフェノキシ）－２－メチルプロピオン酸メチル、２－（４－メトキシフェノキシ）－２－メチルプロピオン酸メチル又は２－（４－ヒドロキシフェノキシ）－２－メチルプロピオン酸メチルが好ましく、ｔ－ブチルフェニルエーテル、イ

ソプロピルフェニルエーテル、1-イソプロポキシ-3-メチルベンゼン又は4-イソプロポキシフェノールがより好ましい。

[0032] 成分Aは、一種類であっても二種類以上であってもよい。

[0033] (成分B)

本発明に係るメタクリル酸メチル含有組成物は、重合禁止剤(成分B)を含むことが好ましい。なお本明細書において重合禁止剤とは、メタクリル酸メチルの重合反応を抑制する機能を有する化合物を意味する。重合禁止剤としては、例えばフェノール系化合物、キノン系化合物、ニトロベンゼン系化合物、N-オキシル系化合物、アミン系化合物、リン含有化合物、硫黄含有化合物、鉄含有化合物、銅含有化合物及びマンガン含有化合物が挙げられる。成分Bを含むことにより、メタクリル酸メチルの保管中に、ラジカル重合機構によるメタクリル酸メチルの重合反応が進行することを抑制できる。また、成分Bはメタクリル酸メチルの保管中に発生する前述のヒドロキシラジカルをトラップすることができる。すなわち、メタクリル酸メチル含有組成物が成分Aに加えて成分Bを含有する場合、成分Aによりヒドロキシラジカルの生成を抑制し、成分Bにより生成したヒドロキシラジカルを除去することができるという、2つの異なる機構でヒドロキシラジカルの量を減少させることができる。よって、メタクリル酸メチル二量体とピルビン酸メチルの生成を効率よく抑制できると考えられる。

[0034] フェノール系化合物である重合禁止剤としては、アルキルフェノール、ヒドロキシフェノール、アミノフェノール、ニトロフェノール、ニトロソフェノール、アルコキシフェノール、トコフェロールなどが挙げられる。

[0035] アルキルフェノールとしては、例えばo-クレゾール、m-クレゾール、p-クレゾール、2-t-ブチル-4-メチルフェノール、2,4-ジメチル-6-t-ブチルフェノール、2,6-ジ-t-ブチル-4-メチルフェノール、2-t-ブチルフェノール、4-t-ブチルフェノール、2,4-ジ-t-ブチルフェノール、2-メチル-4-t-ブチルフェノール、4-t-ブチル-2,6-ジメチルフェノール、2,2'-メチレンビス(6

ー t-ブチル-4-メチルフェノール)、2, 2'-メチレンビス(4-エチル-6-t-ブチルフェノール)、4, 4'-チオビス(3-メチル-6-t-ブチルフェノール)、3, 5-ジ- t-ブチル-4-ヒドロキシトルエン等が挙げられる。

[0036] ヒドロキシフェノールとしては、例えばヒドロキノン、2-メチルヒドロキノン、2-t-ブチルヒドロキノン、2, 5-ジ- t-ブチルヒドロキノン、2, 6-ジ- t-ブチルヒドロキノン、2, 5-ジ- t-アミルヒドロキノン、2-t-ブチルメトキシヒドロキノン、2, 3, 5-トリメチルヒドロキノン、2, 5-ジクロロヒドロキノン、1, 2-ジヒドロキシベンゼン、2-アセチルヒドロキノン、4-メチルカテコール、4-t-ブチルカテコール、2-メチルレゾルシノール、4-メチルレゾルシノール、2, 3-ジヒドロキシアセトフェノン等が挙げられる。

[0037] アミノフェノールとしては、例えば o-アミノフェノール、m-アミノフェノール、p-アミノフェノール、2-(N, N-ジメチルアミノ)フェノール、4-(エチルアミノ)フェノール等が挙げられる。

[0038] ニトロフェノールとしては、例えば o-ニトロフェノール、m-ニトロフェノール、p-ニトロフェノール、2, 4-ジニトロフェノール等が挙げられる。

ニトロソフェノールとしては、例えば o-ニトロソフェノール、m-ニトロソフェノール、p-ニトロソフェノール、 α -ニトロソ- β -ナフトール等が挙げられる。

[0039] アルコキシフェノールとしては、例えば 2-メトキシフェノール、2-エトキシフェノール、2-イソプロポキシフェノール、2-t-ブトキシフェノール、4-メトキシフェノール、4-エトキシフェノール、4-プロポキシフェノール、4-ブトキシフェノール、4-t-ブトキシフェノール、4-ヘプトキシフェノール、ヒドロキノンモノベンジルエーテル、t-ブチル-4-メトキシフェノール、ジ- t-ブチル-4-メトキシフェノール、ピロガロール-1, 2-ジメチルエーテル、ヒドロキノンモノベンゾエート等

が挙げられる。

- [0040] トコフェロールとしては、例えば α -トコフェロール、2, 3-ジヒドロ-2, 2-ジメチル-7-ヒドロキシベンゾフラン等が挙げられる。
- [0041] キノン系化合物である重合禁止剤としては、例えばp-ベンゾキノン、クロロ-p-ベンゾキノン、2, 5-ジクロロ-p-ベンゾキノン、2, 6-ジクロロ-p-ベンゾキノン、テトラクロロ-p-ベンゾキノン、テトラブromo-p-ベンゾキノン、2, 3-ジメチル-p-ベンゾキノン、2, 5-ジメチル-p-ベンゾキノン、メトキシ-p-ベンゾキノン、メチル-p-ベンゾキノン等が挙げられる。
- [0042] ニトロベンゼン系化合物である重合禁止剤としては、例えばニトロベンゼン、o-ジニトロベンゼン、m-ジニトロベンゼン、p-ジニトロベンゼン、2, 4-ジニトロトルエン、ジニトロジュレン、2, 2-ジフェニル-1-ピクリルヒドラジル等が挙げられる。
- [0043] N-オキシル系化合物である重合禁止剤としては、例えば4-ヒドロキシ-2, 2, 6, 6-テトラメチル-ピペリジン-N-オキシル、4-オキソ-2, 2, 6, 6-テトラメチル-ピペリジン-N-オキシル、4-アセトキシ-2, 2, 6, 6-テトラメチル-ピペリジン-N-オキシル、2, 2, 6, 6-テトラメチル-ピペリジン-N-オキシル、ピペリジン-1-オキシル、4-(ジメチルアミノ)-2, 2, 6, 6-テトラメチル-ピペリジン-N-オキシル、4-アミノ-2, 2, 6, 6-テトラメチル-ピペリジン-N-オキシル、4-エタノールオキシ-2, 2, 6, 6-テトラメチル-ピペリジン-N-オキシル、4-ベンゾイルオキシ-2, 2, 6, 6-テトラメチル-ピペリジン-N-オキシル、2, 2, 5, 5-テトラメチル-ピペリジン-N-オキシル、3-アミノ-2, 2, 5, 5-テトラメチル-ピペリジン-N-オキシル、4, 4', 4''-トリス(2, 2, 6, 6-テトラメチル-ピペリジン-N-オキシル)ホスファイト、3-オキソ-2, 2, 5, 5-テトラメチル-ピロリジン-N-オキシル、ピロリジン-1-オキシル、2, 2, 5, 5-テトラメチル-1-オキサ-3-アザシクロペ

ンチル-3-オキシ、2, 2, 5, 5-テトラメチル-3-ピロリニル-1-
 -オキシ-3-カルボン酸、2, 2, 3, 3, 5, 5, 6, 6-オクタメチ
 ル-1, 4-ジアザシクロヘキシル-1, 4-ジオキシ、ジ-*tert*-ブ
 チルニトロキシド、ジ-*tert*-アミルニトロキシド等が挙げられる。

[0044] アミン系化合物である重合禁止剤としては、例えばN, N-ジフェニルア
 ミン、アルキル化ジフェニルアミン、4, 4'-ジクミル-ジフェニルアミ
 ン、4, 4'-ジオクチルジフェニルアミン、4-アミノジフェニルアミン
 、p-ニトロソジフェニルアミン、N-ニトロソジナフチルアミン、N-ニ
 トロソジフェニルアミン、N-ニトロソフェニルナフチルアミン、N-ニ
 トロソフェニルヒドロキシルアミン、N, N'-ジアルキル-p-フェニレン
 ジアミン（アルキル基は同一又は異なってよく、かつそれぞれ互いに無関係
 に1~4個の炭素原子からなり、かつ直鎖状又は分枝鎖状であってよい）、
 N, N'-ジフェニル-p-フェニレンジアミン、N-フェニル-N'-イ
 ソプロピル-p-フェニレンジアミン、N-(1, 3-ジメチルブチル)-
 N'-フェニル-1, 4-フェニレンジアミン、N, N'-ジ-2-ナフチ
 ル-p-フェニレンジアミン、N, N-ジエチルヒドロキシルアミン、1,
 4-ベンゼンジアミン、N-(1, 4-ジメチルペンチル)-N'-フェニ
 ル-1, 4-ベンゼンジアミン、N-(1, 3-ジメチルブチル)-N'-
 フェニル-1, 4-ベンゼンジアミン、6-エトキシ-2, 2, 4-トリメ
 チル-1, 2-ジヒドロキノリン、2, 2, 4-トリメチル-1, 2-ジヒ
 ドロキノリンポリマー、アルドール- α -ナフチルアミン、N-フェニル-
 β -ナフチルアミン、4-ヒドロキシ-2, 2, 6, 6-テトラメチルピペ
 リジン、4-ベンゾイルオキシ-2, 2, 6, 6-テトラメチルピペリジン
 、1, 4-ジヒドロキシ-2, 2, 6, 6-テトラメチルピペリジン、1-
 ヒドロキシ-4-ベンゾイルオキシ-2, 2, 6, 6-テトラメチルピペリ
 ジン等が挙げられる。

[0045] リン含有化合物である重合禁止剤としては、例えばトリフェニルホスフィ
 ン、トリフェニルホスファイト、トリエチルホスファイト、トリス（イソデ

シル) フォスファイト、トリス (トリデシル) フォスファイト、フェニルジ
 イソオクチルフォスファイト、フェニルジイソデシルフォスファイト、フェ
 ニルジ (トリデシル) フォスファイト、ジフェニルイソオクチルフォスファ
 イト、ジフェニルイソデシルフォスファイト、ジフェニルトリデシルフォス
 ファイト、フォスホン酸 [1, 1-ジフェニル-4, 4'-ジイルビステ
 トラキス-2, 4-ビス (1, 1-ジメチルエチル) フェニル] エステル、
 トリフェニルフォスファイト、トリス (ノニルフェニル) フォスファイト、
 4, 4'-イソプロピリデンジフェノールアルキルフォスファイト、トリス
 (2, 4-ジ-tert-ブチルフェニル) フォスファイト、トリス (ビフ
 エニル) フォスファイト、ジステアリルペンタエリスリトールジフォスファ
 イト、ジ (2, 4-ジ-tert-ブチルフェニル) ペンタエリスリトール
 ジフォスファイト、ジ (ノニルフェニル) ペンタエリスリトールジフォスファ
 イト、フェニルビスフェノールAペンタエリスリトールジフォスファイト、
 テトラ (トリデシル) -4, 4'-ブチリデンビス (3-メチル-6-tert-
 ブチルフェノール) ジフォスファイト、ヘキサ (トリデシル) -1,
 1, 3-トリス (2-メチル-4-ヒドロキシ-5-tert-ブチルフェ
 ニル) ブタントリフォスファイト、3, 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒ
 ドロキシベンジルフォスフェートジエチルエステル、ソディウム-ビス (4
 -tert-ブチルフェニル) フォスフェート、ソディウム-2, 2'-メ
 チレン-ビス (4, 6-ジ-tert-ブチルフェニル) フォスフェート、
 1, 3-ビス (ジフェノキシフォスフォニルオキシ) ベンゼン等が挙げられ
 る。

[0046] 硫黄含有化合物である重合禁止剤としては、例えば硫化ジフェニル、フェ
 ノチアジン、3-オキソフェノチアジン、5-オキソフェノチアジン、フェ
 ノチアジン二量体、1, 4-ジメルカプトベンゼン、1, 2-ジメルカプト
 ベンゼン、2-メルカプトフェノール、4-メルカプトフェノール、2-
 (メチルチオ) フェノール、3, 7-ビス (ジメチルアミノ) フェノチアジニ
 ウムクロリド、硫黄 (単体) 等が挙げられる。

- [0047] 鉄含有化合物である重合禁止剤としては、例えば塩化鉄（III）等が挙げられる。
- [0048] 銅含有化合物である重合禁止剤としては、例えばジメチルジチオカルバミン酸銅、ジエチルジチオカルバミン酸銅、ジブチルジチオカルバミン酸銅、サリチル酸銅、酢酸銅、チオシアン酸銅、硝酸銅、塩化銅、炭酸銅、水酸化銅、アクリル酸銅、メタクリル酸銅等が挙げられる。
- [0049] マンガン含有化合物である重合禁止剤としては、ジアルキルジチオカルバミン酸マンガン（アルキル基は、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基の何れかであり、同一であっても、異なってもよい）、ジフェニルジチオカルバミン酸マンガン、蟻酸マンガン、酢酸マンガン、オクタン酸マンガン、ナフテン酸マンガン、過マンガン酸マンガン、エチレンジアミン四酢酸のマンガン塩等が挙げられる。
- [0050] 上記の中でも、メタクリル酸メチル含有組成物の保管中の品質安定性の観点から、成分Bとしては、フェノール系化合物、N-オキシル系化合物、アミン系化合物、リン含有化合物及び硫黄含有化合物からなる群から選択される少なくとも1種の重合禁止剤であることが好ましく、ヒドロキノン、4-メトキシフェノール、2, 4-ジメチル-6-tert-ブチルフェノール、2, 6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール、4-ヒドロキシ-2, 2, 6, 6-テトラメチルピペリジン-N-オキシル、N, N-ジフェニルアミン、N-ニトロソジフェニルアミン、トリフェニルホスファイト及びフェノチアジンからなる群から選択される少なくとも1種の重合禁止剤であることがより好ましい。
- [0051] 成分Bは一種類であっても二種類以上であってもよい。
- なお、メタクリル酸メチル含有組成物に、成分Aと成分Bの両方に該当する化合物が含まれている場合、該化合物は成分Aと見なす。すなわち、メタクリル酸メチル含有組成物が成分A及び成分Bを含む場合は、該化合物とは別の成分Bを含むことを意味する。なお成分Aと成分Bの両方に該当する化合物が2種類以上含まれている場合は、メタクリル酸メチル組成物中のモル

濃度が最も高い化合物を成分Aと見なし、それ以外の化合物を成分Bと見なす。

[0052] (成分A及び成分Bの濃度)

成分Aの濃度をMA ($\mu\text{mol/L}$)、成分Bの濃度をMB ($\mu\text{mol/L}$)としたとき、メタクリル酸メチル二量体及びピルビン酸メチルの生成抑制の効率の観点から、MB/MAは0.005以上であることが好ましい。

またMB/MAの上限は特に制限されないが、通常100以下である。

[0053] MAは1～10000 $\mu\text{mol/L}$ であることが好ましい。MAが1 $\mu\text{mol/L}$ 以上であることにより、メタクリル酸メチル二量体及びピルビン酸メチルの生成を抑制する効果を十分に得ることができる。またMAが10000 $\mu\text{mol/L}$ 以下であることにより、本発明に係るメタクリル酸メチル含有組成物の重合によりメタクリル酸メチル重合体を製造した際の不純物量を少なくし、該重合体の物性に悪影響を与えることを防ぐことができる。MAの下限は10 $\mu\text{mol/L}$ 以上がより好ましく、50 $\mu\text{mol/L}$ 以上がさらに好ましい。MAの上限は5000 $\mu\text{mol/L}$ 以下がより好ましく、3000 $\mu\text{mol/L}$ 以下がさらに好ましく、1000 $\mu\text{mol/L}$ 以下が特に好ましい。

[0054] MBは1～7000 $\mu\text{mol/L}$ であることが好ましい。MBが1 $\mu\text{mol/L}$ 以上であることにより、メタクリル酸メチル二量体及びピルビン酸メチルの生成を抑制する効果を十分に得ることができる。またMBが7000 $\mu\text{mol/L}$ 以下であることにより、本発明に係るメタクリル酸メチル含有組成物の重合によりメタクリル酸メチル重合体を製造した際の不純物量を少なくし、該重合体の物性に悪影響を与えることを防ぐことができる。MBの下限は、10 $\mu\text{mol/L}$ 以上がより好ましく、40 $\mu\text{mol/L}$ 以上がさらに好ましい。MBの上限は、5000 $\mu\text{mol/L}$ 以下がより好ましく、3000 $\mu\text{mol/L}$ 以下がさらに好ましく、1000 $\mu\text{mol/L}$ 以下が特に好ましい。

[0055] (メタクリル酸メチルの濃度)

本発明に係るメタクリル酸メチル含有組成物のメタクリル酸メチルの濃度は、 $99 \sim 99.99$ 質量%である。メタクリル酸メチルの濃度が 99 質量%以上であることにより、本発明に係るメタクリル酸メチル含有組成物の重合によりメタクリル酸メチル重合体を製造した際の不純物量を少なくし、該重合体の物性に悪影響を与えることを防ぐことができる。またメタクリル酸メチルの濃度が 99.99 質量%以下であることにより、精製コストを減少させることができる。メタクリル酸メチルの濃度の下限は 99.8 質量%以上が好ましい。

[0056] (成分C)

本発明に係るメタクリル酸メチル含有組成物は、メタクリル酸メチルの濃度が $99 \sim 99.99$ 質量%を満たす限り、その他の化合物(成分C)を含有してもよい。成分Cとしては、メタクリル酸メチルの製造の過程で生成した不純物などが挙げられる。例えば、メタクリル酸メチルにはジアセチルが不純物として含まれることがあるが、メタクリル酸メチル含有組成物の着色を低減する観点から、ジアセチルの濃度は $55 \mu\text{mol/L}$ 以下であることが好ましく、 $20 \mu\text{mol/L}$ 以下がより好ましく、 $10 \mu\text{mol/L}$ 以下がさらに好ましく、 $1 \mu\text{mol/L}$ が特に好ましい。

[0057] (メタクリル酸メチル含有組成物の分析)

メタクリル酸メチル含有組成物が成分A、成分B、成分C及び水を含有することは、例えばGC-MS測定により確認することができる。メタクリル酸メチル含有組成物のGC-MSチャートにおいて、成分Aの標品と同一の保持時間にピークを有し、該ピークの質量スペクトルで検出される m/z 値が成分Aのexact massと一致すれば、該メタクリル酸メチル含有組成物は成分Aを含有すると判断することができる。成分Aの標品を入手できない場合は、メタクリル酸メチル含有組成物のGC-MSチャートに現れるピークの質量スペクトルのパターンと、質量スペクトルデータベースに収録された成分Aの質量スペクトルのパターンが一致する場合に、該ピークは成分Aピークであると判断することができる。すなわち、該メタクリル酸メ

チル含有組成物が成分Aを含むと判断することができる。質量スペクトルデータベースとしては、NIST20、NIST17、NIST14、NIST14s等が挙げられる。また、揮発性が低くGC-MS測定による検出ができない場合は、LC-MSを用いて検出することができる。成分B、成分C及び水を含有することも同様の方法により確認することができる。

また、メタクリル酸メチルの濃度は、例えばメタクリル酸メチル含有組成物のGC-FID測定を行って面積百分率法を用いて定量し、カルフィッシャー水分計で定量した水分濃度を用いて補正することによって算出することができる。成分Aの濃度は、例えばメタクリル酸メチル含有組成物のGC測定を行い、内部標準法を用いて定量することができる。成分Aの標品を入手することができず、内部標準法によって定量することができない場合は、任意の濃度既知の有機化合物についてメタクリル酸メチル含有組成物と同一条件でGC-FID測定を行い、下記式を用いて成分Aの濃度を算出することができる。

[数1]

$$\text{成分Aの濃度} (\mu\text{mol/L}) = \frac{N}{N_A} \times \frac{S_A}{S} \times M$$

ここで、Nは濃度既知の有機化合物が1分子中に含む炭素原子の個数、 N_A は成分Aが1分子中に含む炭素原子の個数、 S_A は成分Aのピーク面積、Sは濃度既知の有機化合物のピーク面積、Mは濃度既知の有機化合物の濃度 ($\mu\text{mol/L}$) である。

また、揮発性が低く、GC測定による定量ができない場合は、LC等のクロマトグラフィー法を用いて定量することができる。

成分B及び成分Cの濃度も、上記の成分Aと同様の方法により算出することができる。

またメタクリル酸メチル含有組成物が水を含有すること、及びその濃度はカルフィッシャー法により確認できる。

[0058] [メタクリル酸メチル含有組成物の製造方法]

本発明に係るメタクリル酸メチル含有組成物の製造方法としては、メタク

リル酸メチルに成分A及び成分Bを添加する方法が挙げられる。メタクリル酸メチルは市販品を用いてもよく、アセトンシアノヒドリン（ACH）法、新アセトンシアノヒドリン（新ACH）法、C4直接酸化法、直メタ法、エチレン法、新エチレン法など公知の方法で製造したメタクリル酸メチルを用いてもよい。成分A及び成分Bは市販品を用いてもよく、公知の方法で合成したものを用いてもよい。メタクリル酸メチルをアセトンシアノヒドリン（ACH）法、新アセトンシアノヒドリン（新ACH）法、C4直接酸化法、直メタ法、エチレン法、新エチレン法など公知の方法で製造したものを用いる場合、成分A又は成分Bを原料若しくは製造工程のプロセスの途中で添加して、メタクリル酸メチル含有組成物を製造しても構わない。また、メタクリル酸メチル製造プロセスで成分A又は成分Bが副生成物として生成する場合、生成する成分A又は成分Bの一部を残すことでメタクリル酸メチル含有組成物を製造してもよい。

[0059] [保管安定性、熱安定性の評価方法]

本発明に係るメタクリル酸メチル含有組成物は保管中の品質安定性が高い。メタクリル酸メチル含有組成物の保管中の品質安定性の評価方法としては、例えば、実際にメタクリル酸メチル含有組成物を長期間保管して、メタクリル酸メチル二量体及びピルビン酸メチルの生成量を確認する方法が挙げられる。また作業の簡便性の観点から、メタクリル酸メチル含有組成物を短時間加熱して、メタクリル酸メチル二量体及びピルビン酸メチルの生成量を確認する方法を用いてもよい。短時間加熱する場合、加熱温度は50～100℃が好ましく、加熱時間は1～24時間が好ましい。本発明では、メタクリル酸メチル含有組成物を25℃で14日間保管した際のメタクリル酸メチル二量体及びピルビン酸メチルの生成量により、メタクリル酸メチル含有組成物の保管中の品質安定性を評価する。

[0060] [メタクリル酸メチル重合体の製造方法]

本発明に係るメタクリル酸メチル重合体の製造方法は、本発明に係るメタクリル酸メチル含有組成物を含む重合性組成物を重合する工程を含む。

[0061] <重合性組成物>

重合性組成物は、必要に応じて、メタクリル酸メチルと共重合可能な単量体、及びその他の添加物を含んでもよい。

[0062] (メタクリル酸メチルと共重合可能な単量体)

メタクリル酸メチルと共重合可能な単量体としては、例えば下記が挙げられる。

メタクリル酸エチル、メタクリル酸イソプロピル、メタクリル酸n-ブチル、メタクリル酸i s o-ブチル、メタクリル酸t e r t-ブチル、メタクリル酸2-エチルヘキシル、メタクリル酸フェニル、又はメタクリル酸ベンジル等のメタクリル酸エステル；

アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸n-ブチル、アクリル酸i s o-ブチル、アクリル酸t e r t-ブチル、又はアクリル酸2-エチルヘキシル等のアクリル酸エステル；

アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、又はイタコン酸等の不飽和カルボン酸；

無水マレイン酸、又は無水イタコン酸等の不飽和カルボン酸無水物；

N-フェニルマレイミド、又はN-シクロヘキシルマレイミド等のマレイミド；

アクリル酸2-ヒドロキシエチル、メタクリル酸2-ヒドロキシエチル、又はメタクリル酸2-ヒドロキシプロピル等のヒドロキシ基含有ビニル単量体；

酢酸ビニル、又は安息香酸ビニル等のビニルエステル；

塩化ビニル、塩化ビニリデン及びそれらの誘導体；

メタクリルアミド、又はアクリロニトリル等の窒素含有ビニル単量体；

アクリル酸グリシジル、又はメタクリル酸グリシジル等のエポキシ基含有単量体；

スチレン、又は α -メチルスチレン等の芳香族ビニル単量体；

エチレングリコールジ(メタ)アクリレート、1, 2-プロピレングリコー

ルジ（メタ）アクリレート、1，3－ブチレングリコールジ（メタ）アクリレート、又は1，6－ヘキサンジオールジ（メタ）アクリレート等のアルカンジオールジ（メタ）アクリレート；

ジエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ジプロピレングリコールジ（メタ）アクリレート、トリエチレングリコール（メタ）アクリレート、テトラエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ポリエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、又はネオペンチルグリコールジ（メタ）アクリレート等のポリオキシアルキレングリコールジ（メタ）アクリレート；

ジビニルベンゼン等の、分子中に2個以上のエチレン性不飽和結合を有するビニル単量体；

エチレン性不飽和ポリカルボン酸を含む少なくとも1種の多価カルボン酸と少なくとも1種のジオールから得られる不飽和ポリエステルプレポリマー；
エポキシ基の末端をアクリル変性することにより得られるビニルエステルプレポリマー；

[0063] 上記の中でも、メタクリル酸メチルと共重合可能な単量体は、メタクリル酸エステル及びアクリル酸エステルからなる群から選択される少なくとも1種であることが好ましい。これにより、重合性組成物を重合することで、透明性、耐熱性、及び成形性のバランスに優れるメタクリル酸メチル重合体を得ることができる。メタクリル酸メチルと共重合可能な単量体は、アクリル酸エステルであることがより好ましく、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル及びアクリル酸n－ブチルからなる群から選択される少なくとも1種であることが特に好ましい。

[0064] なおメタクリル酸メチルと共重合可能な単量体は、一種類であっても二種類以上であってもよい。また成分Aがメタクリル酸メチルと共重合可能な単量体である場合、成分Aをメタクリル酸メチルと共重合可能な単量体として用いてもよく、成分Aとは別にメタクリル酸メチルと共重合可能な単量体を用いても良い。

[0065] 重合性組成物において、メタクリル酸メチルと共重合可能な単量体の含有

量は、メタクリル酸メチル 100 質量部に対して 0～50 質量部であることが好ましい。これにより、透明性の高いメタクリル酸メチル重合体を得ることができる。メタクリル酸メチルと共重合可能な単量体の含有量の上限は、メタクリル酸メチル 100 質量部に対して 40 質量部以下であることがより好ましく、30 質量部以下であることがさらに好ましい。メタクリル酸メチルと共重合可能な単量体の含有量の下限は、メタクリル酸メチル 100 質量部に対して 0.01 質量部以上であることがより好ましく、0.1 質量部以上であることがさらに好ましく、1 質量部以上であることが特に好ましい。

[0066] (その他の添加剤)

その他の添加剤としては、重合開始剤を含むことが好ましい。また必要に応じて、連鎖移動剤、離型剤、滑剤、可塑剤、酸化防止剤、帯電防止剤、光安定剤、紫外線吸収剤、難燃剤、難燃助剤、重合禁止剤、充填剤、顔料、染料、シランカップリング剤、レベリング剤、消泡剤、蛍光剤等を含んでもよい。なおその他の添加剤は、一種類であっても二種類以上であってもよい。

[0067] 重合開始剤としては、例えば下記が挙げられる。

2, 2'-アゾビスイソブチロニトリル、2, 2'-アゾビス(2-メチルブチロニトリル)、2, 2'-アゾビス(2-メチルプロピオニトリル)、2, 2'-アゾビス(2, 4-ジメチルバレロニトリル)、2, 2'-アゾビス(2, 4, 4-トリメチルペンタン)、2-2'-アゾビス(2-メチルプロパン)、1, 1'-アゾビス(シクロヘキサンカルボニトリル)、ジメチル-2, 2'-アゾビスイソブチレート等のアゾ化合物；

ベンゾイルパーオキシド、2, 5-ジメチル-2, 5-ビス(t-ブチルパーオキシ)ヘキサン、1, 1-ビス(t-ブチルパーオキシ)シクロヘキサン、1, 1-ビス(t-ブチルパーオキシ)-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキサン、t-ブチルパーオキシ-2-エチルヘキサノエート、t-ブチルパーオキシイソブチレート、t-ブチルパーオキシベンゾエート、t-ヘキシルパーオキシベンゾエート、t-ブチルパーオキシイソプロピルモノカーボネート、t-ブチルパーオキシ-3, 5, 5-トリメチルヘキサノエ

ート、*t*-ブチルパーオキシラウレート、*t*-ブチルパーオキシアセテート、*t*-ヘキシルパーオキシイソプロピルモノカーボネート、*t*-ヘキシルパーオキシ-2-エチルヘキサノエート、*t*-アミルパーオキシ-2-エチルヘキサノエート、1, 1, 3, 3-テトラメチルブチルパーオキシエチルヘキサノエート、1, 1, 2-トリメチルプロピルパーオキシ-2-エチルヘキサノエート、1, 1, 3, 3-テトラメチルブチルパーオキシイソプロピルモノカーボネート、1, 1, 2-トリメチルプロピルパーオキシイソプロピルモノカーボネート、1, 1, 3, 3-テトラメチルブチルパーオキシイソノナエート、1, 1, 2-トリメチルプロピルパーオキシイソノナエート、ジ-*t*-ブチルパーオキサイド、ジ-*t*-ヘキシルパーオキサイド、ラウロイルパーオキサイド、ジラウロイルパーオキサイド等の有機過酸化物；過硫酸カリウム等の過硫酸塩化合物；レドックス系重合開始剤；

[0068] 上記の中でも、保存安定性及びメタクリル酸メチルとの反応性の観点から、重合開始剤は、アゾ化合物及び有機過酸化物からなる群から選択される少なくとも1種であることが好ましい。

重合開始剤の使用量は、メタクリル酸メチル及びメタクリル酸メチルと共重合可能な単量体の合計100質量部に対して、0.0001～1質量部が好ましい。

[0069] <重合性組成物の重合方法>

重合方法としては、例えば、塊状重合法、溶液重合法、乳化重合法及び懸濁重合法が挙げられる。溶剤使用等による環境負荷や、得られるメタクリル酸メチル重合体の透明性の観点から、塊状重合法が好ましい。

[0070] 塊状重合法の具体的な手段は特に限定されないが、セルキャスト法又は連続キャスト法等の公知の注型重合法を用いて製造できる。

注型重合法は、周辺を軟質樹脂チューブ等のガスケットでシールして所定間隔で対向配置された2枚の無機ガラス板又は金属板（例えば、SUS板）からなる鋳型に、重合性組成物を注入して重合させ、メタクリル酸メチル重

合体を得る方法である。

注型重合用の鋳型は、特に限定されず、公知の鋳型を用いることができる。セルキャスト用の鋳型としては、例えば、無機ガラス板、クロムメッキ金属板、ステンレス鋼板等の2枚の板状体を所定間隔で対向配置し、その縁部にガスケットを配置して、板状体とガスケットにより密封空間を形成させたものが挙げられる。連続キャスト用の鋳型としては、例えば、同一方向へ同一速度で走行する一対のエンドレスベルトの対向する面と、エンドレスベルトの両側辺部においてエンドレスベルトと同一速度で走行するガスケットとにより密封空間を形成させたものが挙げられる。

[0071] 鋳型の空隙の間隔は所望の厚さの樹脂板が得られるように適宜調整されるが、一般的には1～30mmである。

重合温度は、125～210℃が好ましい。これにより適切な重合速度を得ることができる。重合温度の下限は130℃以上、上限は180℃以下がより好ましい。重合時間は特に限定されず、例えば0.5～24時間とすることができる。

実施例

[0072] 以下、実施例及び比較例により本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。実施例及び比較例中の「%」及び「ppm」は断りのない限り「重量%」及び「重量ppm」を意味する。

試薬のメタクリル酸メチルに含まれる水分濃度は、カールフィッシャー法で算出した。保管前のメタクリル酸メチル含有組成物の構成成分の組成は、各原料の添加量から算出した。保管後のメタクリル酸メチル含有組成物のメタクリル酸メチル二量体及びピルビン酸メチルは、GC-MSを用いて絶対検量線法により定量した。GC-MSの測定条件を以下に示す。

装置：GC-MS測定装置（製品名：QP-2010SE、島津製作所製）

[0073] [GC条件]

カラム（製品名：DB-WAX、アジレント・テクノロジー社製）

長さ：60 m、内径：0.32 mm、膜厚：1.00 μ m

注入量：1.0 μ L

気化室温度：210℃

カラムオープン温度：35℃で10分保持、35℃から150℃まで5℃／分で昇温、150℃で17分保持、150℃から220℃に5℃／分で昇温、220℃で6分保持。

キャリアガス：ヘリウム

注入モード：スプリット（スプリット比50）

制御モード：線速度一定（25.0 cm／秒）

圧力：26.1 KPa

全流量：52.5 mL／分

パージ流量：3.0 mL／分

カラム流量：0.97 mL／分

[0074] [MS条件]

イオン化法：EI (Electron Ionization)

イオン源温度：250℃

インターフェイス温度：250℃

m／z 検出範囲：10～300

検出時間：70分

カールフィッシャー法による水分濃度の定量は、自動水分測定装置（製品名：AQV-2200、平沼産業株式会社製）を用いて行った。

[0075] （実施例1）

成分Aとしてt-ブチルフェニルエーテルを用い、試薬のメタクリル酸メチル（水分濃度240 ppm）10.0065 gに成分A 0.0218 gを添加してメタクリル酸メチル溶液（A-1液）を調製した。該A-1液における成分Aの濃度を表1に示す。

成分Bとして2,4-ジメチル-6-t-ブチルフェノールを用い、試薬のメタクリル酸メチル（水分濃度240 ppm）10.0026 gに成分B

0.0228 g を添加し、メタクリル酸メチル溶液（B－1 液）を調製した。該 B－1 液における成分 B の濃度を表 1 に示す。

次いで、試薬のメタクリル酸メチル（水分濃度 240 ppm）20.0147 g に A－1 液 0.1033 g 及び B－1 液 0.1064 g を添加し、メタクリル酸メチル含有組成物を調製した。該メタクリル酸メチル含有組成物における各成分の濃度を表 2 に示す。

得られたメタクリル酸メチル含有組成物を、25℃で14日間保管した。該保管後のメタクリル酸メチル含有組成物におけるメタクリル酸メチル二量体及びピルビン酸メチルの生成量を表 2 に示す。

[0076]（実施例 2～4）

成分 A として表 1 に示す化合物を用い、試薬のメタクリル酸メチル及び成分 A の量を表 1 に示す通り変更した以外は、実施例 1 と同様にして A－1 液を調製した。

実施例 1 と同様の方法で B－1 液を調製した。

次いで、試薬のメタクリル酸メチル、A－1 液及び B－1 液の量を表 2 に示す通り変更した以外は、実施例 1 と同様にしてメタクリル酸メチル含有組成物を調製した。該メタクリル酸メチル含有組成物における各成分の濃度を表 2 に示す。

得られたメタクリル酸メチル含有組成物を、実施例 1 と同様に保管した。該保管後のメタクリル酸メチル含有組成物におけるメタクリル酸メチル二量体及びピルビン酸メチルの生成量を表 2 に示す。

[0077]（実施例 5～11）

実施例 1 と同様の方法で A－1 液を調製した。

成分 B として表 1 に示す化合物を用い、試薬のメタクリル酸メチル及び成分 B の量を表 1 に示す通り変更した以外は、実施例 1 と同様にして B－1 液を調製した。

次いで、試薬のメタクリル酸メチル、A－1 液及び B－1 液の量を表 2 に示す通り変更した以外は、実施例 1 と同様にしてメタクリル酸メチル含有組

成物を調製した。該メタクリル酸メチル含有組成物における各成分の濃度を表 2 に示す。

得られたメタクリル酸メチル含有組成物を、実施例 1 と同様に保管した。該保管後のメタクリル酸メチル含有組成物におけるメタクリル酸メチル二量体及びピルビン酸メチルの生成量を表 2 に示す。

[0078] (実施例 1 2)

実施例 1 と同様の方法で A-1 液及び B-1 液を調製した。

次いで、試薬のメタクリル酸メチル、A-1 液及び B-1 液の量を表 2 に示す通り変更した以外は、実施例 1 と同様にメタクリル酸メチル含有組成物を調製した。該メタクリル酸メチル含有組成物における各成分の濃度を表 2 に示す。

得られたメタクリル酸メチル含有組成物を、実施例 1 と同様に保管した。該保管後のメタクリル酸メチル含有組成物におけるメタクリル酸メチル二量体及びピルビン酸メチルの生成量を表 2 に示す。

[0079] (実施例 1 3)

実施例 1 と同様の方法で A-1 液を調製した。

試薬のメタクリル酸メチル及び成分 B の量を表 1 に示す通り変更した以外は、実施例 1 と同様に B-1 液を調製した。

次いで、試薬のメタクリル酸メチル、A-1 液及び B-1 液の量を表 2 に示す通り変更した以外は、実施例 1 と同様にメタクリル酸メチル含有組成物を調製した。該メタクリル酸メチル含有組成物における各成分の濃度を表 2 に示す。

得られたメタクリル酸メチル含有組成物を、実施例 1 と同様に保管した。該保管後のメタクリル酸メチル含有組成物におけるメタクリル酸メチル二量体及びピルビン酸メチルの生成量を表 2 に示す。

[0080] (実施例 1 4)

実施例 1 と同様の方法で B-1 液を調製した。

次いで、成分 A として *tert*-ブチルフェニルエーテルを用い、試薬のメタク

リル酸メチル（水分濃度 240 ppm）20.0270 g に成分 A 0.0226 g 及び B-1 液 0.1028 g を添加し、メタクリル酸メチル含有組成物を調製した。該メタクリル酸メチル含有組成物における各成分の濃度を表 2 に示す。

得られたメタクリル酸メチル含有組成物を、実施例 1 と同様に保管した。該保管後のメタクリル酸メチル含有組成物におけるメタクリル酸メチル二量体及びピルビン酸メチルの生成量を表 2 に示す。

[0081]（実施例 15）

実施例 1 と同様の方法で A-1 液及び B-1 液を調製した。

次いで、試薬のメタクリル酸メチル、A-1 液及び B-1 液の量を表 2 に示す通り変更した以外は、実施例 1 と同様にしてメタクリル酸メチル含有組成物を調製した。該メタクリル酸メチル含有組成物における各成分の濃度を表 2 に示す。

得られたメタクリル酸メチル含有組成物を、実施例 1 と同様に保管した。該保管後のメタクリル酸メチル含有組成物におけるメタクリル酸メチル二量体及びピルビン酸メチルの生成量を表 2 に示す。

[0082]（実施例 16～17）

実施例 1 と同様の方法で A-1 液を調製した。

試薬のメタクリル酸メチル及び成分 B の量を表 1 に示す通り変更した以外は、実施例 1 と同様にして B-1 液を調製した。

次いで、試薬のメタクリル酸メチル、A-1 液及び B-1 液の量を表 2 に示す通り変更した以外は、実施例 1 と同様にしてメタクリル酸メチル含有組成物を調製した。該メタクリル酸メチル含有組成物における各成分の濃度を表 2 に示す。

得られたメタクリル酸メチル含有組成物を、実施例 1 と同様に保管した。該保管後のメタクリル酸メチル含有組成物におけるメタクリル酸メチル二量体及びピルビン酸メチルの生成量を表 2 に示す。

[0083]（実施例 18）

実施例 1 と同様の方法で A-1 液を調製した。

次いで、試薬のメタクリル酸メチル（水分濃度 240 ppm）20.0232 g に A-1 液 0.1052 g を添加し、メタクリル酸メチル含有組成物を調製した。該メタクリル酸メチル含有組成物における各成分の濃度を表 2 に示す。

得られたメタクリル酸メチル含有組成物を、実施例 1 と同様に保管した。該保管後のメタクリル酸メチル含有組成物におけるメタクリル酸メチル二量体及びピルビン酸メチルの生成量を表 2 に示す。

[0084]（比較例 1）

実施例 1 と同様の方法で B-1 液を調製した。

次いで、試薬のメタクリル酸メチル（水分濃度 240 ppm）40.0273 g に B-1 液 0.2213 g を添加し、メタクリル酸メチル含有組成物を調製した。該メタクリル酸メチル含有組成物における各成分の濃度を表 2 に示す。

得られたメタクリル酸メチル含有組成物を、実施例 1 と同様に保管した。該保管後のメタクリル酸メチル含有組成物におけるメタクリル酸メチル二量体及びピルビン酸メチルの生成量を表 2 に示す。

[0085]（比較例 2）

試薬のメタクリル酸メチル（水分濃度 240 ppm）40.0000 g を、メタクリル酸メチル含有組成物とし、実施例 1 と同様に保管した。該保管後のメタクリル酸メチル含有組成物におけるメタクリル酸メチル二量体及びピルビン酸メチルの生成量を表 2 に示す。

[0086]（比較例 3）

実施例 1 と同様の方法で B-1 液を調製した。

成分 C としてジアセチルを用い、試薬のメタクリル酸メチル（水分濃度 240 ppm）9.9913 g に成分 C 0.0205 g を添加してメタクリル酸メチル溶液（C-1 液）を調製した。該 C-1 液における成分 C の濃度を表 1 に示す。

次いで、試薬のメタクリル酸メチル（水分濃度 240 ppm）40.0218 g に B-1 液 0.2151 g 及び C-1 液 0.2069 g を添加し、メタクリル酸メチル含有組成物を調製した。該メタクリル酸メチル含有組成物における各成分の濃度を表 2 に示す。

得られたメタクリル酸メチル含有組成物を、実施例 1 と同様に保管した。該保管後のメタクリル酸メチル含有組成物におけるメタクリル酸メチル二量体及びピルビン酸メチルの生成量を表 2 に示す。

[0087]（比較例 4）

試薬のメタクリル酸メチル及び成分 B の量を表 1 に示す通り変更した以外は、実施例 1 と同様に B-1 液を調製した。

次いで、試薬のメタクリル酸メチル、成分 A 及び B-1 液の量を表 2 に示す通り変更した以外は、実施例 1 4 と同様にメタクリル酸メチル含有組成物を調製した。該メタクリル酸メチル含有組成物における各成分の濃度を表 2 に示す。

得られたメタクリル酸メチル含有組成物を、実施例 1 と同様に保管した。該保管後のメタクリル酸メチル含有組成物におけるメタクリル酸メチル二量体及びピルビン酸メチルの生成量を表 2 に示す。

[0088]（比較例 5）

実施例 1 と同様の方法で A-1 液を調製した。

試薬のメタクリル酸メチル及び成分 B の量を表 1 に示す通り変更した以外は、実施例 1 と同様に B-1 液を調製した。

次いで、試薬のメタクリル酸メチル（水分濃度 240 ppm）20.0064 g に A-1 液 0.1106 g、B-1 液 0.0993 g 及び純水 0.2937 g を添加し、メタクリル酸メチル含有組成物を調製した。該メタクリル酸メチル含有組成物における各成分の濃度を表 2 に示す。

得られたメタクリル酸メチル含有組成物を、実施例 1 と同様に保管した。該保管後のメタクリル酸メチル含有組成物におけるメタクリル酸メチル二量体及びピルビン酸メチルの生成量を表 2 に示す。

[0089] [表1]

表1

	A-1液				B-1液				C-1液			
	試薬の MMA 添加量 [g]	化合物名	添加量 [g]	濃度 [ppm]	試薬の MMA 添加量 [g]	化合物名	添加量 [g]	濃度 [ppm]	試薬の MMA 添加量 [g]	化合物名	添加量 [g]	濃度 [ppm]
実施例1	10.0065	ト-ブチルフェニルエーテル	0.0218	2174	10.0026	2,4-ジメチル-6-tert-ブチルフェニール	0.0228	2274	—	—	—	—
実施例2	10.0163	イソプロピルフェニルエーテル	0.0225	2241	10.0026	2,4-ジメチル-6-tert-ブチルフェニール	0.0228	2274	—	—	—	—
実施例3	10.0166	1-イソプロピル-3-メチルベンゼン	0.0229	2281	10.0026	2,4-ジメチル-6-tert-ブチルフェニール	0.0228	2274	—	—	—	—
実施例4	10.0116	4-イソプロピルシフェニール	0.0214	2133	10.0026	2,4-ジメチル-6-tert-ブチルフェニール	0.0228	2274	—	—	—	—
実施例5	10.0065	ト-ブチルフェニルエーテル	0.0218	2174	10.0051	4-メトキシフェニール	0.0191	1905	—	—	—	—
実施例6	10.0065	ト-ブチルフェニルエーテル	0.0218	2174	10.0238	ヒドロキノン	0.0233	2319	—	—	—	—
実施例7	10.0065	ト-ブチルフェニルエーテル	0.0218	2174	10.0204	フェノキサジン	0.0238	2370	—	—	—	—
実施例8	10.0065	ト-ブチルフェニルエーテル	0.0218	2174	10.0021	4-ヒドロキシ-2,2,6,6-テトラメチルピペリジン-N-オキシド	0.0202	2016	—	—	—	—
実施例9	10.0065	ト-ブチルフェニルエーテル	0.0218	2174	10.1244	N,N-ジフェニルアミン	0.0222	2188	—	—	—	—
実施例10	10.0065	ト-ブチルフェニルエーテル	0.0218	2174	10.0077	N-ニトロジフェニルアミン	0.0208	2074	—	—	—	—
実施例11	10.0065	ト-ブチルフェニルエーテル	0.0218	2174	10.0061	N-フェニルホルスワイト	0.0223	2224	—	—	—	—
実施例12	10.0065	ト-ブチルフェニルエーテル	0.0218	2174	10.0026	2,4-ジメチル-6-tert-ブチルフェニール	0.0228	2274	—	—	—	—
実施例13	10.0065	ト-ブチルフェニルエーテル	0.0218	2174	40.0221	2,4-ジメチル-6-tert-ブチルフェニール	0.0829	2067	—	—	—	—
実施例14	—	—	—	—	10.0026	2,4-ジメチル-6-tert-ブチルフェニール	0.0228	2274	—	—	—	—
実施例15	10.0065	ト-ブチルフェニルエーテル	0.0218	2174	10.0026	2,4-ジメチル-6-tert-ブチルフェニール	0.0228	2274	—	—	—	—
実施例16	10.0065	ト-ブチルフェニルエーテル	0.0218	2174	40.0221	2,4-ジメチル-6-tert-ブチルフェニール	0.0829	2067	—	—	—	—
実施例17	10.0065	ト-ブチルフェニルエーテル	0.0218	2174	40.0221	2,4-ジメチル-6-tert-ブチルフェニール	0.0829	2067	—	—	—	—
実施例18	10.0065	ト-ブチルフェニルエーテル	0.0218	2174	—	—	—	—	—	—	—	—
比較例1	—	—	—	—	10.0026	2,4-ジメチル-6-tert-ブチルフェニール	0.0228	2274	—	—	—	—
比較例2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
比較例3	—	—	—	—	10.0026	2,4-ジメチル-6-tert-ブチルフェニール	0.0228	2274	9.9913	シアセチル	0.0205	2048
比較例4	—	—	—	—	40.0221	2,4-ジメチル-6-tert-ブチルフェニール	0.0829	2067	—	—	—	—
比較例5	10.0065	ト-ブチルフェニルエーテル	0.0218	2174	40.0221	2,4-ジメチル-6-tert-ブチルフェニール	0.0829	2067	—	—	—	—

[0090]

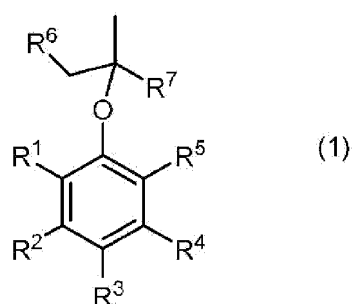
[0091] 本発明によれば、アクリル樹脂の原料等に用いることができるメタクリル酸メチル含有組成物を長期間安定に保管することができ、工業的に有用である。

請求の範囲

[請求項1] メタクリル酸メチルと、下記式（１）で表されるアリールアルキルエーテル化合物（成分Ａ）と、を含む、メタクリル酸メチル含有組成物であって、

 メタクリル酸メチルの濃度が９９～９９．９９質量％である、メタクリル酸メチル含有組成物。

[化1]



（上記式（１）中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 及び R^7 は、独立して、水素原子、アルキル基、アルケニル基、アリール基、ヒドロキシ基、アルコキシ基、アミノ基、カルボニル基を含む１価の基、アルキルチオ基又はアリールチオ基を表す。）

[請求項2] 前記成分Ａの濃度を MA （ $\mu\text{mol/L}$ ）としたとき、 MA が１～１００００ $\mu\text{mol/L}$ である、請求項１に記載のメタクリル酸メチル含有組成物。

[請求項3] 前記 MA が１０～５０００ $\mu\text{mol/L}$ である、請求項２に記載のメタクリル酸メチル含有組成物。

[請求項4] 前記成分Ａの分子量が２０００以下である、請求項１に記載のメタクリル酸メチル含有組成物。

[請求項5] 更に重合禁止剤（成分Ｂ）を含む、請求項１に記載のメタクリル酸メチル含有組成物。

[請求項6] 前記成分Ａの濃度を MA （ $\mu\text{mol/L}$ ）とし、前記成分Ｂの濃度を MB （ $\mu\text{mol/L}$ ）としたとき、 MB/MA が０．００５以上で

ある、請求項5に記載のメタクリル酸メチル含有組成物。

- [請求項7] 前記成分Bの濃度をMB ($\mu\text{mol/L}$)としたとき、MBが1～7000 $\mu\text{mol/L}$ である、請求項5に記載のメタクリル酸メチル含有組成物。
- [請求項8] 前記MBが10～5000 $\mu\text{mol/L}$ である、請求項7に記載のメタクリル酸メチル含有組成物。
- [請求項9] 前記成分Bが、フェノール系化合物、キノン系化合物、ニトロベンゼン系化合物、N-オキシル系化合物、アミン系化合物、リン含有化合物、硫黄含有化合物、鉄含有化合物、銅含有化合物及びマンガン含有化合物からなる群から選択される少なくとも1種の重合禁止剤である、請求項5に記載のメタクリル酸メチル含有組成物。
- [請求項10] 前記成分Bが、フェノール系化合物、N-オキシル系化合物、アミン系化合物、リン含有化合物、及び硫黄含有化合物からなる群から選択される少なくとも1種の重合禁止剤である、請求項5に記載のメタクリル酸メチル含有組成物。
- [請求項11] 前記成分Bが、ヒドロキノン、4-メトキシフェノール、2,4-ジメチル-6-tert-ブチルフェノール、2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール、4-ヒドロキシ-2,2,6,6-テトラメチルピペリジン-N-オキシル、N,N-ジフェニルアミン、N-ニトロソジフェニルアミン、トリフェニルホスファイト及びフェノチアジンからなる群から選択される少なくとも1種の重合禁止剤である、請求項5に記載のメタクリル酸メチル含有組成物。
- [請求項12] メタクリル酸メチルの濃度が99.8～99.99質量%である、請求項1に記載のメタクリル酸メチル含有組成物。
- [請求項13] ジアセチルを含有しない、又は含有するジアセチルの濃度が55 $\mu\text{mol/L}$ 以下である、請求項1に記載のメタクリル酸メチル含有組成物。
- [請求項14] 前記式(1)中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 及び R^7 がそれぞれ

れ独立して、水素原子、炭素原子数 1 ～ 5 のアルキル基、炭素原子数 2 ～ 5 のアルケニル基、炭素原子数 1 ～ 12 のアリール基、ヒドロキシ基、炭素原子数 1 ～ 6 のアルコキシ基、アミノ基又はカルボニル基を含む 1 価の基である、請求項 1 に記載のメタクリル酸メチル含有組成物。

[請求項15] 前記式 (1) 中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 及び R^7 がそれぞれ独立して、水素原子、炭素原子数 1 ～ 5 のアルキル基、ヒドロキシ基、炭素原子数 1 ～ 5 のアルコキシ基又は炭素原子数 2 ～ 6 のアルコキシカルボニル基である、請求項 1 に記載のメタクリル酸メチル含有組成物。

[請求項16] 前記式 (1) 中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 及び R^7 がそれぞれ独立して、水素原子、メチル基、*t*-ブチル基、ヒドロキシ基、メトキシ基又はメトキシカルボニル基である、請求項 1 に記載のメタクリル酸メチル含有組成物。

[請求項17] 請求項 1 から 16 のいずれか一項に記載のメタクリル酸メチル含有組成物を含む重合性組成物を重合する工程を含む、メタクリル酸メチル重合体の製造方法。

[請求項18] 前記重合性組成物が、メタクリル酸メチルと共重合可能な単量体を含む、請求項 17 に記載のメタクリル酸メチル重合体の製造方法。